走査顕微鏡光学系を利用した位相計測

(財)高輝度光科学研究センター 高野 秀和

概要

走査型硬 線顕微鏡光学系を利用した高空間分解位相イメージングについて述 べる。試料を透過した集光ビームの回折パターンをすべての走査点において画像検 出器で記録し、強度重心の移動量を求めることにより基準点からの位相差を求める ことができる。これを利用して位相再構成を行う。SPring-8のアンジュレータービ ームライン BL20XU において、8 keV の 線を光源としたマイクロビーム光学系を 用いた実験及び得られた結果について述べる。

はじめに

物質における 線の位相変化は複素屈折率 n=1-δ-iβを用いて記述される。 線 のエネルギーが高いほど、また物質の原子番号が小さいほど一般的にδ/Bが大き くなるために、位相変化を利用したイメージングは従来の吸収イメージングに 比べて非常に高い感度が期待できる。 試料での位相変化の定量は、 干渉計⁽¹⁾、 ホ ログラフィ⁽²⁾を利用した手法などがあり、CT 再構成を利用した3次元イメージ ングにも成功している。しかしながら、これらは基本的に投影光学系であるた め、回折による空間分解能の低下が問題となる。軟 線領域では、Zernike 位相 差顕微鏡⁽³⁾、暗視野顕微鏡^(4,5)、微分位相顕微鏡⁽⁶⁾など、顕微鏡光学系の位相イ メージングへの応用が行われてきており、高い空間分解能での観察が可能とな っている。また、Wigner-distribution deconvolution 法を用いた位相回復法⁽⁷⁾、回 折像からの位相回復法⁽⁸⁾などの、位相定量の試みもなされている。硬 線領域に おいては、例えば生物の切片試料などは透過率が高すぎるために、吸収コント ラストを用いた観察は基本的に困難である。しかしながら、位相イメージング を利用することによるコントラストの向上がなされれば、大気中、溶液中など 様々な雰囲気での観察が非常に容易となるほか、線による試料の照射損傷を 抑える効果等も期待できる。近年の硬線領域における結像光学系、マイクロ ビーム光学系等の顕微光学系は急速に開発が進んでおり、サブミクロン~サブ 100 nm の高い空間分解能を達成している⁽⁹⁻¹¹⁾。位相イメージングにおいても、 Zernike 位相差顕微鏡^(12,13)等で硬 線領域における高分解能観察がなされてお り、その高感度性が示されている。本研究では、硬 線マイクロビーム走査顕 微鏡光学系を用いた高空間分解能位相定量について試みた。SPring-8 における 全長 248 mのビームライン BL20XU を用いて構築されたコヒーレントマイクロ

ビーム光学系、及びそれを用いた実験結果等について述べる。

実験光学系

図1に実験光学系の概要を示す。BL20XUは Hybrid型X線アンジュレータを 光源として有し、液体窒素循環冷却型Si111二結晶分光器により8~27 keVの 硬線を供給する。分光器直後には仮想光源として用いるための矩形開口(100 µm、50µm、20µm)及びスリット開口(10µm)が挿入可能であり、この光源 から最下流の実験ハッチ入口まで距離が195mあるため、高い空間コヒーレン スを有する線を用いた実験が可能である。

線集光素子として、フレネルゾーンプレート(FZP)を用いた。ゾーンは厚さ 1 µm のタンタルでできており、その最外線幅は 100 nm である。FZP の直径は 150 µm であり、十分なコヒーレンスで照明するため、50 µm の仮想光源を用い た。直径 20 µm のピンホールによって FZP の一次回折による集光ビームのみを 選択する。実験では 8 keV の 線を用いた。生成したマイクロビームはナイフ エッジスキャン法で評価を行い、縦横方向ともに強度半値幅 150 nm のサイズが 得られている。光学系の最下流には可視光変換型画像検出器を配置した。検出 器は P43 シンチレーター、光学リレーレンズ、高速読み出し型冷却 CCD カメ ラ (浜松ホトニクス: C4742-98)から構成されており、試料を透過したマイク ロビームの回折像を記録する。



図1 SPring-8、BL20XUを用いた 線マイクロビーム光学系

位相定量法

マイクロビームが試料を透過する際、試料の位相勾配に応じて 線の屈折が 起こる。一次元系において、ビームサイズΔx に対して試料の位相勾配がΔφであ るとき、その屈折角θは 線の波数 k を用いて、

$$\theta = \frac{1}{k} \left(\frac{d\phi}{dx} \right) \tag{1}$$

として表される。屈折角は画像検出器で検出された回折像の強度重心の移動として観測されるため、試料を走査することにより試料の微分位相マップが得られる。テストチャート(タンタル厚さ 0.5 μ m)を用いて得られた、横、縦方向の微分位相像を図 2(a)、2(b))にそれぞれ示す。これらの像から、ある基準点からの経路積分を行うことにより相対的な位相マップが得られる。再構成した位相像を図 2(c)に示す。位相 *Phase(x,y)*は、計算の簡略化のため、横、縦方向の微分位相像を *DX(x,y)*、*DY(x,y)*(いずれも *x=0~xn*、*y=0~yn*)とし、基準点を(0,0)としたとき、

$$Phase(x, y) = \left[\sum_{y=0}^{y} DY(0, y) + \sum_{x=yn}^{y} \{-DY(0, y)\}\right] / 2 + \left[\sum_{x=0}^{x} \{-DX(x, y)\} + \sum_{x=xn}^{x} DX(x, y)\right] / 2$$
(2)

として求めた。図 2(c)中に白線で示された場所における位相分布を図 2(d)に示 す。厚さ 0.5 μm のタンタルに対する 8 keV の 線の位相変化は 0.26π rad であ り、ほぼ理論値に近い位相定量ができていることがわかる。



図2 テストチャート(厚さ 0.5 mm タンタル)の微分位相像及び位相再構成像 (a): 微分位相像(横方向)(b):微分位相像(縦方向)(c):微分位相像より再構成した位相像。 (d):(c)において白線で表示された場所の位相分布。走査速度 6.5 Hz、ステップ 50 nm のラ スタースキャンにより得られた。画像の濃度はそれぞれ(a):0.102π(白)~-0.105π(黒) (b):0.107π(白)~-0.110π(黒)(c):0.291π(白)~-0.175π(黒)のリニアグレースケー ル。

吸収像との比較

弱吸収物体として、直径 0.5 mm のガラス球を用いた測定を行った。透過率は 8 keV の X 線に対して 99.6%である。図 3 (a)に位相像、図 3(b)にイオンチャン

バー (Air:14 cm)を用いて同時に計測した吸収像を示す。吸収では見ることの できない球体の重なり具合が明瞭に観察できており、位相像の感度の高さを示 している。



500 nm

図2 直径 0.5 mm ガラス球の位相像及び吸収像 (a):位相像、(b):吸収像。走査速度 6.5 Hz、ステップ 50 nm のラスタースキャンにより得ら れた。画像の濃度はそれぞれ(a):1.005(白)~0.987(黒),(b):-0.064π(白)~0.037π(黒) (吸収像との比較のため正方向が黒)のリニアグレースケール。

References

- (1) A. Momose, T. Takeda, Y. Itai and K. Hirano, Nature Medicine 2, (1996) 473.
- (2) P. Cloetens, W. Ludwig, J. Baruchel, D. Van Dyck, J. Van Landuyt, J. P. Guigay and M. Schlenker, *Appl. Phys. Lett.* **75**, (1999) 2912.
- (3) G. Schmahl, D. Rudolph, P. Guttmann, G. Shneider, J. Thieme and B. Niemann, *Rev. Sci. Intsrim.* **66**, (1995) 1282.
- (4) H. N. Chapman, C. Jacobsen and S. Williams, Ultramicroscopy 62, (1996) 191.
- (5) H. Takano, K. Yokota and S. Aoki, Jpn. J. Appl. Phys. 38, (1999) L1485.
- (6) H. N. Chapman, C. Jacobsen and S. Williams, Rev. Sci. Instrum. 66, (1995) 1332.
- (7) H. N. Chapman, Ultramicroscopy 62, (1996) 153.
- (8) J. Miao, P. Charalambous, J. Kirz and D. Sayre, Nature 400, (1999) 342.
- (9) W. Yun, B. Lai, Z. Cai, J. Maser, D. Legnini, E. Gluskin, Z. Chen, A. A. Krasnoperova, Y. Vladimirsky, F. Cherrina, E. Di. Fabrizio and M. Gentili, Rev. Sci. Instrum. **70** (1999) 2238.
- (10)A. Takeuchi, H. Takano, K. Uesugi and H. Takano, Proc. SPIE 4499 (2002) 29.
- (11)N. Kamijo, Y. Suzuki, M. Awaji, A. Takeuchi, H. Takano, T. Ninomiya, S. Tamura and M. Yasumoto: *J. Synchrotron Rad.* **9** (2002) 182.
- (12)N. Watanabe, S. Aoki, H. Takano, K. Yamamoto, A. Takeuchi, H. Tsubaki and T. Aota, "X-RAY MICROSCOPY", XRM99, Aug 2-6, 1999, Berkeley CA, USA, W. Meyer-Ilse, T. Warwick and D. Attwood eds., (American Institute of Physics, Melville, NY, 2000) pp. 84.
- (13)Y. Kagoshima, T. Ibuki, Y. Yokoyama, Y. Tsusaka, J. Matsui, K. Takai and M. Aino, *Jpn. J. Appl. Phys.* **40**, (2001) L1190